

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014年5月15日(15.05.2014)



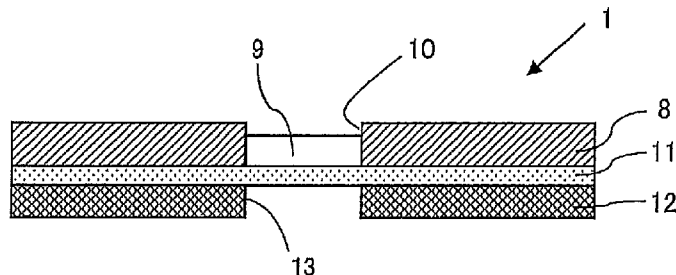
(10) 国際公開番号

WO 2014/073344 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 37/22 (2012.01) *H01L 21/304* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/078092
- (22) 国際出願日: 2013年10月16日(16.10.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-246403 2012年11月8日(08.11.2012) JP
- (71) 出願人: 東洋ゴム工業株式会社(TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 数野 淳(KAZUNO, Atsushi); 〒5508661 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目17番18号 東洋ゴム工業株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人 ユニウス国際特許事務所 (UNIUS PATENT ATTORNEYS OFFICE); 〒5320011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目13-9 新大阪MTビル1号館 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: MULTILAYER POLISHING PAD

(54) 発明の名称: 積層研磨パッド



(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide a multilayer polishing pad having a long service life, which is not susceptible to separation between a polishing layer and a cushion layer even in cases where the multilayer polishing pad is at high temperatures due to long-time polishing, thereby causing no defect in the cushion layer even after long-time polishing. A multilayer polishing pad of the present invention is obtained by laminating a polishing layer and a cushion layer with an adhesive member interposed therebetween. This multilayer polishing pad is characterized in that: the adhesive member is an adhesive layer that contains a polyester hot melt adhesive, or a double-sided tape that has the adhesive layer on both sides of a base; the adhesive layer or the double-sided tape has a non-adhesive region that occupies 1-40% of the surface area; and the polyester hot melt adhesive contains 2-10 parts by weight of an epoxy resin having two or more glycidyl groups in each molecule per 100 parts by weight of a polyester resin in that serves as the base polymer.

(57) 要約: 本発明は、長時間の研磨により高温になる場合であっても研磨層とクッション層との間で剥離しにくく、長時間研磨を行ってもクッション層に欠陥が生じない長寿命の積層研磨パッドを提供することを目的とする。本発明の積層研磨パッドは、研磨層とクッション層とが接着部材を介して積層されており、前記接着部材は、ポリエステル系ホットメルト接着剤を含む接着剤層、又は基材の両面に前記接着剤層を有する両面テープであり、前記接着剤層又は前記両面テープは、表面積に対して1~40%の非接着領域を有しており、前記ポリエステル系ホットメルト接着剤は、ベースポリマーであるポリエステル樹脂100重量部に対して、1分子中にグリシジル基を2つ以上有するエポキシ樹脂を2~10重量部含有することを特徴とする。

WO 2014/073344 A1